

# お 知 ら せ

## 電子・磁気機能

- 3H7 31 イオン伝導を有するアルミニウムランタンリン酸塩融液固化物(中部大工) 魚江康輔・鈴木一富・宮内俊幸・盛 秀彦・渡辺誠・阿部良弘
- 3H7 32\* 磁性 Ni P 中空マイクロ繊維の作製と磁場による垂直配向(東工大資源研) 宇田津 満・石井大佑・中川 勝・彌田智一・長嶋太一・川崎真一・山田光昭

座長 瀧宮 和男(14:30~15:10)

- 3H7 34 液晶性有機半導体材料の開発(東工大像情報工学研・大日本印刷研究開発セ) 徳永圭治・半那純一
- 3H7 35 新規光導電性電荷移動型二成分液晶の合成と光電変換特性(青山学院大理工) 藤原真彦・野辺陽子・岩堀史靖・阿部二郎
- 3H7 36 アモルファス分子材料を用いる有機電界効果トランジスタの作製と評価(阪大院工) 中尾真人・景山 弘・城田靖彦
- 3H7 37 ビス(2-アリアルエチニル)チオフェンを基盤とする有機薄膜トランジスタ材料(京大院工) 清水正毅 萩原恵美子・八尋正幸・檀山爲次郎・秋山誠治・前田修一

座長 木口 学(15:20~16:00)

- 3H7 39 構造の明確な長鎖オリゴチオフェンを用いた溶液プロセスによるFET素子の作製とその特性(広島大院工) 坂本勝洋・瀧宮和男・大坪徹夫・豊嶋雄太・功刀義人・安蘇芳雄
- 3H7 40 ナフトジチオフェン誘導体のFET特性(広島大院工・広島大総科) 瀧宮和男・功刀義人・大坪徹夫・豊嶋雄太
- 3H7 41 ベンゾセレノフェン骨格を基盤とした新規有機FET材料の開発(広島大院工) 近田安史・瀧宮和男・大坪徹夫・功刀義人・豊嶋雄太
- 3H7 42 電子求引性置換基を導入したベンゾジカルコゲノフェン誘導体のFET特性(広島大院工・広島大総科) 江端英昭・近田安史・瀧宮和男・大坪徹夫・功刀義人・豊嶋雄太

座長 秋山 誠治(16:00~17:00)

- 3H7 43 脂環式化合物を側鎖に有するポリシロキサン電子線特性(阪府技研) 井上陽太郎・櫻井芳昭
- 3H7 44\* 溶液内における金属ナノワイヤーの構造制御(北大院理・さきがけ) 木口 学・小西達也・三浦進一・村越 敬
- 3H7 46 溶液内金属ナノ接合における分子吸着によるコンダクタンス量子化学的安定化(北大理・さきがけ) 三浦進一・小西達也・木口学・村越 敬
- 3H7 47\* 金属塩添加多孔質アルミナによる水吸着型蓄熱(東工大原子炉研・東工大総理工) 劉 醇一・永井恒輝・加藤之貴・秋鹿研一

## K1 会場

23号館 201教室

## 未来材料

3月27日午後

座長 篠原 久典(13:00~14:00)

- 2K1 25 招待講演 C,Si,Ge ナノ材料の物性と応用(東北大院理) 谷垣勝己

座長 谷垣 勝己(14:00~15:00)

- 2K1 31 依頼講演 カーボンナノチューブの選択的合成法の開発とその評価(名大院理) 篠原久典
- 2K1 34 依頼講演 内包フラーレンの化学修飾とその展開(筑波大先端学際領域研究セ) 赤阪 健

座長 赤阪 健(15:10~17:00)

- 2K1 38 口頭C講演 高次フラーレンの簡便な精製方法およびその応用(フロンティアカーボン) 永田浩一・出島栄治・菊地康晴・橋口昌彦
- 2K1 40 依頼講演 ナノカーボンの電池への応用(信州大繊維) 東原秀和
- 2K1 43 依頼講演 ナノカーボンの燃料電池への応用(NEC基礎・環

境研) 久保佳実

- 2K1 46 口頭D講演 ナノ電解法による有機導体ナノデバイスの作成(情報通信研西) 長谷川裕之・上田里永子・久保田 徹・益子信郎

3月28日午後

座長 田路 和幸(9:00~10:20)

- 3K1 01 依頼講演 規則性ナノ空間の特異な触媒作用(東工大資源研) 岩本正和
- 3K1 04 依頼講演 ゼオライト中に安定化された高密度ナノ物質の創製とその物性(産総研・さきがけ) 小平哲也
- 3K1 07 口頭C講演 微粒子状メソポーラスシリカの合成(トクヤマ) 福田健太郎・石津賢一・上田雅英

座長 岩本 正和(10:30~11:40)

- 3K1 10 依頼講演 ストラティファイド光触媒と水素製造(東北大院環境・東北大多元研・日鉄鉱業) 田路和幸・荒井健男・松本高利・松本博道・篠田弘道
- 3K1 13 口頭C講演 ルチル型二酸化チタンを用いた可視光応答型光触媒の開発(九工大) 豊福真紀・横野照尚
- 3K1 15 口頭C講演 FePt ナノ粒子媒体における磁気特性及び電磁変換特性の粒子サイズ依存(富士写真フイルム記録メディア研・富士写真フイルム先進コア技術研) 服部康志・脇 幸吉・小池理士・神沢志保・井上健一郎・古澤元一

3月28日午後

座長 細野 秀雄(13:00~15:30)

- 3K1 25 依頼講演 タンデムクライゼン転位を經由する新規超分子システムの構築とその応用(宇都宮大工) 平谷和久
- 3K1 28 口頭C講演 ビビリジン部位を有する $\pi$ 共役系のセンシング機能に関する理論(産総研ナノテク) 下位幸弘・MANG, Chaoyon・小林伸彦・小山恵美子・中村 徹・石田敬雄・阿部修治
- 3K1 30 依頼講演 蛍光性分子のレーザーマイクロ注入・固定(物材機構材料研) 後藤真宏・土佐正弘・笠原 章
- 3K1 33 口頭C講演 高感度な分子認識をめざす分子機能デバイスの研究開発(産総研ナノテク) 川西祐司・横山 浩
- 3K1 35 口頭D講演 液相反応による粒子へのナノ薄膜被覆技術の開発(日鉄鉱業研究開発セ・東北大学) 岸本 章・小倉慎一・伊藤貴裕・松本博道・渡部武照・新子貴史・中塚勝人
- 3K1 38 口頭C講演 固体電解質ナノ薄膜・ナノファイバーの湿式プロセス(九工大工) 片峰 暁・清水陽一

座長 多田 博一(15:40~17:00)

- 3K1 41 口頭C講演 超高解像電子線露光レジストの開発(トクヤマつくば研・日本電気環境基礎研・日本電気R&Dユニット中央研) 名塚康隆・東野誠司・落合幸徳・石田真彦・成廣 充
- 3K1 43 招待講演 透明電子活性酸化物(東工大フロンティア創造共同研究セ) 細野秀雄

座長 谷垣 勝己(17:00~18:00)

- 3K1 49 依頼講演 有機トランジスターの最近の進展(分子研・総研大・CREST) 多田博一
- 3K1 52 依頼講演 有機半導体材料・デバイスの研究開発の現状と将来(九大院総理工) 筒井哲夫

## K2 会場

23号館 203教室

## 未来材料

3月27日午後

## 男女共同参画—エコ材料とエネルギー

座長 武田 邦彦(13:00~15:30)

- 2K2 25 招待講演 プロジェクトXからプロジェクトWへ(愛知大

# お 知 ら せ

法 坂東昌子

- 2K2 29 口頭D講演 二酸化炭素を原料とした炭酸エステルの革新的製造方法(旭化成ケミカルズ化学技術研究セ) 三宅信寿・大西一広・渡辺智也・永原 肇
- 2K2 32 口頭C講演 二酸化炭素の接触水素化による炭化水素の合成(産総研関西セ) 相馬芳枝・藤原正浩・安藤尚功・除 強
- 2K2 34 依頼講演 新クリーン燃料DME(JFE 技研ディーエムイー開発) 大野陽太郎
- 2K2 37 依頼講演 鉄製造プロセスにおける急冷凝固中不純物有効利用(物材機構) 小林能直

## 男女共同参画ーエコ材料と電子

座長 相馬 芳枝(15:30~17:40)

- 2K2 40 口頭C講演 溶融析出法による太陽電池用シリコン製造技術の開発(トクヤマ) 若松 智・小田 開行
- 2K2 42 依頼講演 地球温暖化ガスPFCを用いずにエッチング可能な低誘電率絶縁膜システム(産総研)内丸祐子
- 2K2 45 口頭C講演 有機溶剤を用いない銅張積層板用プリプレグ製法の開発(住友ベークライト次世代基板材料研究開発プロジェクトチーム・名大高等研究院) 小林広行・東崎栄造・古川禎史・武田邦彦
- 2K2 47 口頭C講演 フライアッシュを利用した低製造エネルギーの難燃性ポリカーボネート樹脂の開発(日本電気基礎・環境研) 曾山誠・井上和彦・位地正年
- 2K2 49 口頭C講演 弱酸性殺菌水製造装置が拓く水処理技術とその効果 クリアフィールドウォーター(CFW)(逸見電機エンジニアリング・オー・エム・シー・イオン化学・都立高専) 逸見秀孝・奥山光男・苅野 仁・田村健治
- 2K2 51 口頭C講演 非 RI LLNA 法の開発とリスクアセスメントへの応用(ダイセル化学工業評価・解析セ) 山下邦彦・出原賢治・伊藤美智雄

3月28日午前

## 男女共同参画ーエコ材料と機能

座長 赤井 智子(9:20~10:40)

- 3K2 03 口頭C講演 イオン半導体が拓く新技術I イオン半導体による溶媒和電子の発生法(イオン化学・都立高専) 苅野 仁・田村健治
- 3K2 05 口頭C講演 イオン半導体が拓く新技術II フライ帝王(イオン化学・イオン技研・都立高専) 苅野 仁 竹内広海・田村健治
- 3K2 07 口頭C講演 イオン半導体が拓く新技術III リバゲイン(イオン化学・オー・エム・シー・都立高専) 苅野 仁 奥山光男・田村健治
- 3K2 09 口頭C講演 疎水性官能基で修飾したポーラスシリカ被覆二酸化チタン粒子の開発とその光触媒活性(九工大) 垣内康輔・横野照尚

座長 小野 幸子(10:40~12:00)

- 3K2 11 依頼講演 廃物を利用してできる高付加価値の蛍光ガラス(産総研) 赤井智子
- 3K2 14 口頭C講演 耐環境性有機無機ナノハイブリッド膜の合成と応用(産総研エネルギー技術) 本間 格・金 濟徳
- 3K2 16 依頼講演 結晶学的手法による多孔質炭素材料の構造解析(産総研) 吉澤徳子

3月28日午後

## 男女共同参画ーエコ材料

座長 本間 格(13:00~14:10)

- 3K2 25 依頼講演 エコ材料としての軽金属と表面(工学院大工) 小野幸子
- 3K2 28 口頭C講演 アセタール結合の導入によるケミカルリサイクル性ポリウレタン材料の開発(福井大工) 橋本 保
- 3K2 30 口頭C講演 リサイクル可能な形状記憶性バイオプラスチックの開発(NEC 基礎・環境研究所) 山城 緑・井上和彦・位地正年

## エコ材料と有害物質

座長 行本 正雄(14:30~16:40)

- 3K2 34 口頭C講演 高分子材料中のカドミウムと鉛の定量分析方法(生命館大理工・滋工セ) 坂山邦彦・安田尚樹・白石晴樹・松田十四夫・高木一好
- 3K2 36 口頭C講演 内視鏡用超音波・オゾン洗浄滅菌機の開発(明星大理工) 原 正憲・西山恭平・安堵城 悟・清水光弘・嶋原學徳・上田豊甫
- 3K2 38 依頼講演 日本における有害物質の循環(名大院工・住友ベークライト・名大高等研究院) 遠藤小太郎・棚橋 満・小笹維義・武田邦彦

## 男女共同参画ーエコ材料と文化

- 3K2 41 招待講演 衣服の洗浄と環境 共立女大 齊藤昌子
- 3K2 45 口頭C講演 セルロースの構造異方性とそれに起因する二つの表面特性(神戸大・旭化成・徳島文理大工) 山根千弘・青柳岳司・岡島邦彦

座長 齊藤 昌子(16:40~17:50)

- 3K2 47 依頼講演 伝統に学ぶ高分子材料(計算流体力学研・名大) 井戸理恵子・武田邦彦
- 3K2 50 招待講演 21世紀における環境と材料(名大高等研究院) 武田邦彦

## K 3 会場

23号館 204 教室

## 半導体用材料の開発最前線

3月27日午後

座長 大場 隆之(13:00~15:00)

- 2K3 25 招待講演 65nm以降のLSI適用に向けたポーラスLow k材料(富士通研究所) 灰野 映
- 2K3 29 招待講演 32/45nm世代のポーラスLow k/Cu配線対応のダメージフリーCMP技術(半導体先端テクノロジー) 近藤誠一
- 2K3 33 招待講演 プラズマCVDによる低誘電率材料の合成(東大院工) 霜垣幸浩

座長 霜垣 幸浩(15:10~17:40)

- 2K3 38 依頼講演 ナノクラスタリングシリカ技術を用いた塗布系低誘電率材料(触媒化成工業) 荒尾弘樹・江上美紀・中島 昭
- 2K3 41 依頼講演 PECVD法による新規ボラジン系低誘電率膜(三菱電機先端総研) 熊田輝彦・笹原敦子・松本紀久・保田直紀・信時英治・豊島利之・松野繁
- 2K3 44 依頼講演 低誘電率層間絶縁膜材料とそのインテグレーション(ハネウェルジャパン) 中野 正
- 2K3 47 依頼講演 多孔質低誘電率膜の微細構造(山梨大) 近藤英一
- 2K3 50 依頼講演 CVD用low k原料の評価手順(トリケミカル研究所) 町田英明

3月28日午前

座長 近藤 英一(9:00~12:00)

- 3K3 01 招待講演 Cu/Low k配線インテグレーションにおける技術課題(ルネサステクノロジ) 松浦正純
- 3K3 05 依頼講演 プラズマ共重合法による有機系低誘電率材料開発(半導体MIRAIプロジェクト-ASET) 木下啓藏
- 3K3 08 口頭C講演 TMCTS疎水化処理によるポーラスシリカLow k膜の特性改善(半導体MIRAIプロジェクト-ASET・半導体MIRAI・産総研ASRC・広島大RCNS) 田中博文・高村一夫・大池俊輔・村上雅美・清野 豊・吉川公磨
- 3K3 11 口頭C講演 プラズマ共重合Low k膜における機械強度の制御(半導体MIRAIプロジェクト-ASET・半導体MIRAI・産総研ASRC・広島大RCNS) 川原 潤・国見信孝・中野昭典・木下啓藏・林喜宏・小松聖史・清野 豊・市川理恵・高須ゆう子・吉川公磨
- 3K3 13 口頭C講演 プラズマ共重合技術による新規な有機Low k材料(MIRAI-ASET・住友化学・MIRAI-ASRC・広島大RCNS) 小

# お 知 ら せ

- 松聖史・国見信孝・川原 潤・中野昭典・木下啓蔵・吉川公彦  
3K3 15 口頭C講演 C<sub>2</sub>F<sub>4</sub>/C<sub>2</sub>F<sub>6</sub>を用いた低誘電率aC:F膜のPECVD合成(東大院工) 渡部博樹・霜垣幸浩  
3K3 17 口頭C講演 周波数可変マイクロ波を用いたポリイミド前駆体膜の低温硬化(日立化成・日立化成デュボンマイクロシステムズ・ラムダテクノロジーズ) 松谷 寛・服部孝司・大江匡之・上野 巧・HUBBARD, Robert, L.・FATHI, Zak

## 3月28日午後

座長 西岡 岳(13:10~13:50)

- 3K3 26 招待講演 新規エッチングガスを用いた半導体微細加工プロセス(名大院工) 堀 勝

座長 堀 勝(13:50~16:00)

- 3K3 30 招待講演 半導体製造におけるCMP技術開発(東芝セミコンダクター社) 西岡 岳・矢野博之  
3K3 34 依頼講演 環境に優しいガスを用いたエッチング技術(超先端電子技術開発機構) 伊藤 仁  
3K3 38 口頭C講演 地球温暖化防止ガスを用いたシリコン酸化膜エッチング(和歌山大・名大院工) 伊藤昌文・堀 勝  
3K3 40 依頼講演 ドライエッチングプロセスにおけるプラズマ制御(ソニー) 辰巳哲也・安藤厚博

座長 西岡 岳(16:00~17:00)

- 3K3 43 口頭C講演 Cu CMP用砥粒レス”ミセルスラリー”の開発(旭化成ケミカルズ・埼玉大) 沖田光史・松下文夫・船越真二・高橋秀明・土肥俊郎  
3K3 45 口頭C講演 講演中止  
3K3 47 口頭C講演 銅CMPスラリーの開発(富士写真フィルム) 山下宏宏

## K 4 会場

### 23号館 205 教室

#### 半導体用材料の開発最前線

## 3月27日午後

座長 白井 正充(13:00~14:00)

- 2K4 25 口頭C講演 アダマンタン系アクリレートの合成と機能(ダイセル化学工業) 井上慶三・伊奈智秀・長野慎哉・水島隆博・足立知子  
2K4 27 口頭C講演 電子材料用途向け有機化合物の製造における金属イオン汚染防止とそのビジネス(三協化成) 川口弘行・白川一也  
2K4 29 口頭C講演 フラン環を末端に有する低分子アモルファス材料の開発(和歌山県工業技術セ) 森 一・野村英作・細田朝夫・三宅靖仁・伊藤 修・谷口久次

座長 船木 克典(14:00~15:00)

- 2K4 31 口頭C講演 化学増幅型主鎖切断レジスト樹脂の合成検討(丸善石油化学) 三田孝仁 青木 聖  
2K4 33 口頭C講演 化学増幅型主鎖切断レジストのリソ評価(丸善石油化学) 三田孝仁  
2K4 35 口頭C講演 リソグラフィー材料としての多核フェノール類(本州化学工業) 岩井竜也・良知 照・松石和也・守田如志・西川淳・塩見泰一・江川健志

座長 斎藤 聡(15:10~17:00)

- 2K4 38 口頭C講演 重合プロセスがArFレジスト用ポリマーの性能に及ぼす影響(ダイセル化学工業) 奥村有道・新井 隆・堤 聖晴・栗原 一・宝来 晃  
2K4 40 口頭C講演 ArFレジストの精密合成とその特性(阪府大院工) 白井正充 坂井幸一・小柳達史・岡村晴之  
2K4 42 依頼講演 光パターニング用高分子ナノシート材料(東北大多元研) 三ツ石方也  
2K4 45 口頭C講演 高分子薄膜中での光カチオン重合を用いたリソグラフィー材料(千葉大工) 朴 チョルホ・岩城 仁・宮川信一・

- 高原 茂  
2K4 47 口頭C講演 一重項増感剤と光酸発生剤からなる高感度フォトポリマー材料(千葉大工) 岩城 仁・高原 茂・宮川信一・鈴木昭太・朴 チョルホ

## 3月28日午前

座長 有光 晃二(9:00~10:20)

- 3K4 01 口頭C講演 多環芳香環を有する分子性レジスト材料の評価(三菱ガス化学平塚研) 小黑 大・越後雅敏  
3K4 03 依頼講演 高感度・高解像電子線レジスト材料の開発(東芝) 齋藤 聡・中杉哲郎  
3K4 06 依頼講演 高感度レジストを目指した酸発生剤の電子線固相反応(原研高崎) 前川康成・吉田 勝・榎本一之

座長 前川 康成(10:30~11:50)

- 3K4 10 招待講演 感光性ポリイミド, ポリベンズオキサゾールの新展開(東工大理工工) 上田 充  
3K4 14 口頭C講演 低誘電特性を有する感光性ポリアリアルエーテルケトン(三井化学マテリアルサイエンス研) 後藤謙一・鎌田潤・玉井正司  
3K4 16 口頭C講演 溶解性変換剤を用いた高コントラスト化学増幅型感光性ポリベンズオキサゾール(日立化成・日立化成デュボンマイクロシステムズ) 峯岸知典・田鎖寿紀・加藤幸治

## 3月28日午後

座長 三ツ石 方也(13:00~14:40)

- 3K4 25 依頼講演 反応現象型感光性ポリマー(横国大院工) 大山俊幸  
3K4 28 依頼講演 塩基増殖反応を利用した光パターニング材料(東理大理) 有光晃二  
3K4 31 招待講演 リソグラフィ技術とレジスト材料(松下電器産業半導体社) 遠藤政孝

座長 高原 茂(14:50~16:50)

- 3K4 36 口頭C講演 次世代半導体リソグラフィーレンズ用大型CaF<sub>2</sub>単結晶(日立化成工業総合研) 住谷圭二 Senguttuvan, Nachimuthu・石橋浩之・青島真裕  
3K4 38 依頼講演 微細加工リソグラフィーのための反射防止膜材料(日産化学工業電子材料研) 中島康之  
3K4 41 口頭C講演 リフロー用 新規 ArFレジストの開発(住友化学) 武元一樹 吉田 勲・李 榮濬・藤 裕介・橋本和彦・宮川貴行・山口訓史・高橋憲司・小西伸二  
3K4 43 口頭C講演 ArF液浸リソグラフィー用レジスト開発(富士写真フィルム) 神田博美・漢那慎一・稲部陽樹・山本 慶・水谷一良  
3K4 45 依頼講演 ArFリソグラフィー用レジスト材料(東京応化工業) 緒方寿幸・平山 拓・羽田英夫・岩井 武・大森克実・小野寺純一

## K 5 会場

### 23号館 206 教室

#### ディスプレイ用材料の開発最前線

## 3月27日午後

### OLED: デバイス

座長 城田 靖彦(15:40~17:20)

- 2K5 41 依頼講演 ソニーのトップエミッション有機ELディスプレイ(ソニーマイクロシステムズネットワークカンパニー) 松田英介  
2K5 43 依頼講演 三洋電機の有機ELディスプレイ(三洋電機) 斎藤伸郎  
2K5 45 依頼講演 高分子材料を用いた有機ELディスプレイ(セイコーエプソン) 深瀬章夫  
2K5 47 依頼講演 赤色燐光素子の実用化検討(バイオニア総研) 辻大志・川見 伸・宮口 敏

# お 知 ら せ

2K5 49 依頼講演 光アドレス有機ELデバイス(阪大院工) 横山正明・中山健一

3月28日午前

## OLED: 発光材料

座長 當摩 照夫(9:00~9:40)

3K5 01 招待講演 有機EL発光材料の新しい展開~りん光材料を中心に~(NHK 技研) 時任静士

座長 時任 静士(9:40~11:50)

3K5 05 依頼講演 有機EL材料(低分子及び高分子材料)の開発状況について(アビシア) 伊藤雅康

3K5 07 依頼講演 OLED用ドーパントの開発(林原生物化学研) 梶月真

3K5 09 依頼講演 有機ELの超寿命化(出光興産) 細川地潮

3K5 12 依頼講演 リン光材料 光物理過程と有機LEDへの応用(JST・CREST 千歳科大・Universal Display Co.) 河村祐一郎・合志憲一・Jason Brooks・Julie J. Brown・雀部博之・安達千波矢

3K5 14 口頭C講演 ジフェニルキノキサリン イリジウム化合物の合成と赤色りん光OLEDへの応用(阪大院工・阪大FRC・三洋電機MD技開セ) 藤井祐行・櫻井英博・谷 和恭・MAO, Lisheng・脇坂健一郎・平尾俊一

3K5 16 依頼講演 イリジウム錯体のりん光物性の理論予測プログラムの開発(阪大院理) 野崎浩一

3月28日午後

## OLED: 輸送材料

座長 當摩 照夫(13:00~13:40)

3K5 25 招待講演 有機ELキャリア輸送材料の開発動向(三菱化学科学技術研究セ) 佐藤佳晴

座長 佐藤 佳晴(13:40~15:10)

3K5 29 依頼講演 新日鐵化学の有機EL材料開発(新日鐵化学) 伊斐孝弘

3K5 32 依頼講演 正孔注入・輸送材料の開発(バンドー化学・福井工大) 稲田 宏・松井洋介・古畑知一・赤司信隆・榎 知幸・林知子・城田靖彦

3K5 34 依頼講演 電子輸送材料の開発 チッソ株式会社における検討(チッソ石油化学) 内田 学・生田利昭

3K5 36 依頼講演 有機EL素子用アモルファス分子材料(福井工大・阪大院工) 城田靖彦・奥本健二・土井秀軽・前田将規・山手俊彦・橋本慶介・田中正健・景山 弘

## OLED: 周辺材料

座長 横山 正明(15:20~16:50)

3K5 39 依頼講演 有機EL用透明捕水剤(OleDry®)の現況と今後の展望(双葉電子工業) 高橋尚光・田中 哲・稗田 茂・鶴岡誠久

3K5 41 依頼講演 有機EL封止技術(スリーポンド) 堀江賢一

3K5 44 依頼講演 有機EL用薄膜乾燥材の開発(ダイニック) 大山兼人・内堀輝男

3K5 46 依頼講演 OLED用バリアフィルム(凸版印刷総研) 小林裕・小森常範・武田 晃・宇山晴夫

## K 6 会場

23号館 208 教室

## ディスプレイ用材料の開発最前線

3月27日午後

## LCD: 材料動向

座長 池田 富樹(13:50~15:30)

2K6 30 招待講演 LCDの重要性和それを支える材料(東北大院工) 内田龍男

## LCD: ビジネス

2K6 34 招待講演 LCDの最新動向と今後の展望 シャープ 石井裕

## LCD: デバイス

2K6 38 依頼講演 IPS TFT液晶ディスプレイの最近の進展と将来性(日立日立研) 近藤克己

## LCD: 基板・電極

座長 近藤 克己(15:40~17:10)

2K6 41 依頼講演 TFT LCD用ガラス基板のトレンドと物性(旭硝子中央研) 加瀬準一郎

2K6 43 依頼講演 LCDガラス基板(コーニングジャパン) 飯田剛志  
2K6 46 依頼講演 フレキシブルディスプレイ用透明導電性フィルム(帝人) 花田 亨・白石 功・水谷 圭・城 尚志

2K6 48 依頼講演 ZnO:Al透明導電膜の開発(東ソー東京研) 内海健太郎・飯草仁志・鈴木祐一・浜田見哲夫

3月28日午前

## LCD: 配向膜・CF

座長 高津 晴義(9:00~11:10)

3K6 01 依頼講演 LCD用液晶配向膜の開発動向(JSRディスプレイ研) 西川通則

3K6 04 口頭D講演 液晶配向膜の表面結晶性が液晶配向性に及ぼす影響(日産化学工業・高輝度光科学研究セ) 酒井隆宏・筒井皇晶・後藤耕平・志田啓文・石津谷正英・広沢一郎

3K6 07 依頼講演 液晶ディスプレイ用カラーフィルタについて(凸版印刷) 糸井 健

3K6 09 口頭C講演 液晶ディスプレイ用カラーフィルター作製システム「トランサー」の開発(富士写真フィルムデジタル&フォトイメージング材料研) 大谷薫明

3K6 11 依頼講演 ロール・ツー・ロールによるフレキシブルカラーフィルタの作成(TRADIM・JSR・住友ベークライト・大日本印刷) 江口敏正・曾根原章夫・松崎 敦・熊野厚司・伊藤剛史・高橋達見

## LCD: 液晶

座長 内山 昭彦(11:10~12:10)

3K6 14 依頼講演 液晶材料の高速応答化に対する取り組み(チッソ石化五井研) 梁井元樹・川宿田浩明・久保恭宏・松下哲也

3K6 16 依頼講演 アクティブマトリックス駆動LCD用液晶材料(メルクル)ノ瀬秀男

3K6 18 依頼講演 AM LCD用含フッ素縮合環系液晶(大日本インキ化学工業) 高津晴義

3月28日午後

## LCD: 位相差 F

座長 内山 昭彦(13:10~13:30)

3K6 26 依頼講演 アートンによる位相差フィルム(JSR高分子研) 小宮 全

座長 分元 博文(13:30~14:50)

3K6 28 口頭C講演 液晶性高分子を用いたLCD用光学フィルム(新日本石油中研) 真崎仁詩・豊岡武裕

3K6 30 依頼講演 LCD用補償フィルムの光学設計(富士写真フィルムFPD材料研究所) 森 裕行

3K6 32 依頼講演 OCB方式LCD用光学補償フィルムの開発(富士写真フィルム) 伊藤洋士

3K6 34 依頼講演 位相差フィルムの分子設計による複屈折率の波長分散制御に関する研究(帝人エレクトロニクス研) 内山昭彦

## LCD: 偏光板・反射

座長 森 裕行(14:50~15:30)

# お 知 ら せ

- 3K6 36 依頼講演 液晶TV用偏光板とOCBモード(サンリツ)溝口隆一・小林一彦・大塚至人・猪股貴道・善如寺芳弘  
3K6 38 依頼講演 液晶ディスプレイ用光学フィルムの開発(大日本印刷産業資材研) 斎藤 律・片桐博臣・中村典永

## LCD:輝度向上・導光板

座長 苗村 省平(15:40~16:50)

- 3K6 41 依頼講演 LCD用輝度上昇フィルム(住友スリーエム) 中久喜英夫  
3K6 44 依頼講演 高機能性導光板を用いた高輝度液晶バックライトの研究(日本ライツ) KALIL KALANTAR  
3K6 46 依頼講演 異方性散乱シートの設計(ダイセル化学工業) 平石政憲・大西雅也・林 正樹・寺内利浩・須田 聡・泉谷辰雄・西田善行

## LCD:デバイス

座長 石井 裕(16:50~17:50)

- 3K6 48 依頼講演 How to improve large TFT LCD displays for TV (based on IPS Technology) LG.Philips LCD) 洪 永泰・金 佑烈  
3K6 51 依頼講演 OCB方式液晶表示の最新技術(東芝松下ディスプレイテクノロジー) 分元博文

## K 7 会場

### 23号館 209 教室

## 実装用材料の開発最前線

3月27日午後

座長 高橋 健司(13:00~14:30)

- 2K7 25 基調講演 常温接合と実装エコデザインの課題(東大院工・物材機構) 須賀唯知  
2K7 30 招待講演 新しい有機材料による微細多層配線プロセス(産総研) 青柳昌宏

座長 福岡 義孝(14:40~16:20)

- 2K7 35 招待講演 三次元実装技術の開発と課題(東芝セミコンダクター社) 高橋健司  
2K7 39 口頭C講演 吸湿時の硬化性に優れた新規硬化促進剤の合成と特性(日立化成工業総合研) 中村真也・松井 恵・片寄光雄  
2K7 41 口頭C講演 ポリイミド接着フィルムの表面構造と加熱温度との相関(日立化成工業総合研) 中山紀行・武田信司・金 文錫  
2K7 43 口頭C講演 ダイアタッチフィルムの低温接着化(三井化学機能材料研) 児玉洋一

座長 青柳 昌宏(16:30~17:50)

- 2K7 46 依頼講演 エアロゾルデポジション法による誘電体材料の常温成膜と応用(産総研・東工大・富士通) 明渡 純・南 ソンミン・森正和・鶴見敬章・今中佳彦  
2K7 49 口頭C講演 キャパシタ内蔵基板用高誘電率絶縁シート(日立化成工業総合研) 神代 恭・平田善毅・熊倉俊寿・田邊貴弘  
2K7 51 依頼講演 選択的濡れ性を利用した開口部形成法(協立科学産業・アトムニクス研究所) 上村太一・杉谷雅夫・熊倉昌義・畑田賢造

3月28日午前

座長 近藤 和夫(9:00~11:00)

- 3K7 01 招待講演 受動部品/膜素子内臓ビルドアップ配線板の開発と課題(ウェイスティール) 福岡義孝  
3K7 05 依頼講演 ポリイミド系ビルドアップ材料の開発(カネカエレクトロニクス研) 田中 滋・伊藤 卓・西中 賢・下大迫寛司・村上睦明  
3K7 08 口頭C講演 次世代パッケージ基板用ビルドアップ材料(日立化成工業総合研) 森田高示・高根沢 伸・渡辺貴子・熊倉俊寿・深井弘之

- 3K7 10 依頼講演 ビルドアップ多層基板用層間絶縁フィルム材「ABF」の開発(味の素ファインテクノ電子・機能材料事業本部) 真子玄迅

座長 高橋 健司(11:10~12:10)

- 3K7 14 依頼講演 ポリイミド樹脂の表面改質を利用するダイレクトメタラリゼーション(甲南大) 縄舟秀美  
3K7 17 依頼講演 多孔質基板を用いた高密度3次元配線技術の開発(東芝研究開発セ) 澤登美紗・堀田康之・真竹 茂・山田 紘・平岡俊郎

3月28日午後

座長 高橋 健司(13:10~13:50)

- 3K7 26 口頭C講演 耐熱性多孔シート素材の開発(ダイセル化学工業総合研) 露本美智男・大和 洋・船木克典  
3K7 28 口頭C講演 ナノペースト®を用いたインクジェット印刷によるパターン形成(ハリマ化成筑波研) 齊藤 寛・上田雅行・松葉頼重

座長 青柳 昌宏(14:00~16:20)

- 3K7 31 招待講演 微小めっき技術(阪府大院工) 近藤和夫  
3K7 35 依頼講演 無電解めっき方式による半導体用超微細パンプ形成技術(アトムニクス研究所) 畑田賢造・江守善雄  
3K7 38 口頭C講演 プリント配線板へのプロファイルフリー銅箔の適用(日立化成工業総合研) 小川信之・小野関 仁・田邊貴弘・熊倉俊寿  
3K7 41 口頭C講演 窒化アルミニウムの高熱伝導化機構(トクヤマ) 池田 奨・東 正信・江崎龍夫  
3K7 43 口頭C講演 高出力LED用AlN基板(トクヤマつくば研) 山本泰幸・前田昌克

## K 8 会場

### 23号館 210 教室

## 光学材料の開発最前線

3月27日午後

座長 戒能 俊邦(13:00~15:00)

- 2K8 25 基調講演 有機発光半導体デバイス研究のこれから(千歳科技大) 窪部博之  
2K8 30 招待講演 発光・受光トランジスタ用有機半導体とデバイス特性評価(千葉大) 江藤一浩  
2K8 34 依頼講演 光通信波長帯有機発光材料とデバイスへの展開(NTTフォトニクス研) 鈴木博之

座長 工藤 一浩(15:10~17:30)

- 2K8 38 依頼講演 プラスチック・エレクトロニクス・フォトニクス(産総研) 八瀬清志・齊藤和裕・吉田郵司・原 浩二郎・近松真之・當摩哲也・永松秀一  
2K8 41 口頭C講演 含硫黄高屈折率フォトリソマの調製と二光子吸収リソグラフィ(日立化成工業・コーネル大) 村上泰治・Ober, Christopher, K.  
2K8 43 依頼講演 光書き込み型リライト材料と無線ICタグ(RFID)の複合化(理研) 和田達夫  
2K8 46 口頭C講演 過渡吸収分光法による光機能材料の評価(産総研) 加藤隆二・渡邊禎之・村井美紀・玉城喜章・古部昭広  
2K8 48 口頭C講演 フォトリフラクティブ材料における光変化の特徴と素子化(理研) 佐々高史・武藤豪志・和田達夫・藤原 隆・武田洋典・梅垣真祐  
2K8 50 口頭C講演 電子線照射による有機結晶光素子作製(東北大多元研) 阿部 徹・小松京嗣・杉原興浩・戒能俊邦

3月28日午前

座長 尾崎 雅則(9:00~10:30)

- 3K8 01 招待講演 分子フォトニクス材料・デバイスの展開(九大院

# お 知 ら せ

工)長村利彦

- 3K8 05 口頭C講演 高強度高分子繊維の熱物性を利用した光学材料への応用(東洋紡績総合研・京工維大) 山中淳彦・野村幸弘・平畑裕嗣・尾江邦重
- 3K8 07 依頼講演 有機色薄膜積層型マイクロ熱レンズ形成素子を用いる光路切替スイッチの開発(大日精化工業技術研究センター基盤技術研) 田中教雄

座長 長村 利彦(10:40~12:20)

- 3K8 11 依頼講演 ナノ周期構造液晶のフォトニクス応用(阪大院工) 尾崎雅則・吉野勝美
- 3K8 14 口頭C講演 ナノプリント技術による微細構造作製と有機材料(NTT物性科学基礎研) 濱尾 篤
- 3K8 16 依頼講演 高分子材料の光機能化のためのプロセス技術(産総研) 谷垣宣孝・望月博孝・溝黒登志子・莫 晓亮・平賀 隆・吉田郵司・八瀬清志
- 3K8 19 口頭C講演 希土類イオンドープポリイミドナノ粒子の特異な発光特性(東北大多元研) 石坂孝之・笠井 均・中西八郎

3月28日午後

座長 伊藤 雄三(13:20~15:10)

- 3K8 27 招待講演 高速光伝送・高画質ディスプレイのためのフォトニクスポリマー(慶大理工・ERATO) 小池康博・多加谷明広
- 3K8 31 口頭C講演 GI型プラスチック光ファイバー「LUMISTAR」の開発(富士写真フイルム R&D 統括本部) 佐藤真隆
- 3K8 33 依頼講演 モバイルディスプレイ用工学部材の開発(東農工大院共生科学技術・住友化学工業) 渡辺敏行・風間優子・戸谷健朗・林 秀樹・内藤茂樹
- 3K8 36 口頭C講演 強靱性かつ耐熱性に優れた光学材用エポキシ樹脂(ダイセル化学工業) 平川裕之・前嶋 尚・高井英行・佐藤篤志・圓尾且也

座長 小池 康博(15:20~17:20)

- 3K8 39 招待講演 ポリマー光導波路の作製と展覧(東北大多元研) 戒能俊邦
- 3K8 43 依頼講演 新規ポリマー導波路用材料及び導波路素子(日立電線アドバンス技術研) 平野光樹・安井裕紀・牛渡剛真・阿部富也・伊藤雄三
- 3K8 46 口頭C講演 ポリマー光導波路を用いた波長分波技術(日立化成工業総合研) 柴田智章・高橋敦之
- 3K8 48 依頼講演 フッ素ポリイミドのフィルム転写と光導波路への応用(三井化学機能材料研) 塩田剛史

## L1 会場

23号館301教室

未来材料

3月27日午後

座長 赤木 和夫(13:00~14:00)

- 2L1 25 招待講演 電極活物質としての有機ラジカルポリマー(早大理工) 西出宏之
- 2L1 28 依頼講演 イオン液体(東農工大院共生科学技術) 犬野弘幸

座長 大野 弘幸(14:00~14:50)

- 2L1 31 依頼講演 高分子電解質のプロトン輸送ならびPEFCとしての機能(上智大理工) 陸川政弘
- 2L1 34 口頭C講演 有機金属錯体ナノ薄膜電極を用いた環境イオンセンサ(九工大工) 中村一雄・高瀬聡子・清水陽一

座長 西出 宏之(15:00~16:00)

- 2L1 37 依頼講演 高分子ナノシート集積による光・電気応答素子(東北大多元研) 宮下徳治
- 2L1 40 依頼講演 テラヘルツ波発生のための有機イオン性結晶(山形大工・東北大多元研) 岡田修司・谷内哲夫・中西八郎

座長 宮下 徳治(16:00~17:00)

- 2L1 43 依頼講演 フォトクロミック分子による電気・光物性スイッチング(奈良先端大物質科学教育研究セ) 河合 壯
- 2L1 46 口頭D講演 共役錯体のレドックススイッチング機能(阪大院工) 森内敏之・高木義弘・四折 淳・平尾俊一

3月28日午前

座長 金藤 敬一(9:00~10:00)

- 3L1 01 招待講演 液晶融合電子ポリマー(筑波大学際物質科学研究セ) 赤木和夫
- 3L1 04 依頼講演 DNA/ポリアニリン高次組織体の構造と機能(千葉大工) 小林範久

座長 小林 範久(10:00~11:30)

- 3L1 07 口頭D講演 超高速リビングカチオン重合による刺激応答性高分子の合成(阪大院理) 青島貞人・吉田友秀・金澤有紘・金岡鍾局
- 3L1 10 依頼講演 筋肉を超える導電性高分子のソフトアクチュエータ(九大院生命科学工) 金藤敬一
- 3L1 13 依頼講演 導電性高分子/ $C_{60}$ 相互浸透界面の作製と光電変換応用(阪大院工) 藤井彰彦・梅田時由・橋本友樹・水上大義・野田秀樹・尼崎雅則・吉野勝美

座長 藤井 彰彦(11:30~12:30)

- 3L1 16 口頭C講演 デザイン型フェノールの精密重合によるナノマテリアルへの創製(金沢大院自然・NEDO) 小西玄一
- 3L1 18 口頭C講演 レーザー照射ガス発生フィルムの開発(ダイセル化学工業総合研) 大和 洋・米田幹生・露本美智男・船木克典
- 3L1 20 口頭C講演 レーザー色素ドーピング法による有機EL素子の作製(ダイセル化学工業総合研) 北口 透・船木克典

3月28日午後

座長 安蘇 芳雄(13:30~14:30)

- 3L1 28 依頼講演 カーボンナノチューブ研究への化学的アプローチ(九大院工) 中嶋直敏
- 3L1 31 依頼講演 光学活性RW/R/Switchモードをすべて可能にするらせんポリシラン薄膜(奈良先端大物質・学振) 藤木道也・内藤昌信・大平昭博

座長 藤木 道也(14:30~15:30)

- 3L1 34 依頼講演 新規のチオフェン系ハイブリッドオリゴマーの導電性と発光特性(京工織大繊維) 堀田 収
- 3L1 37 依頼講演 ナノ共役オリゴチオフェンの開発と応用(阪大産研・CREST/JST) 安蘇芳雄

座長 堀田 収(15:40~16:40)

- 3L1 41 依頼講演 デンドリマー液晶の配向制御と光機能性(山形大工) 米竹孝一郎
- 3L1 44 依頼講演 トリアジン系機能性高分子材料(岩手大工) 大石好行

座長 米竹 孝一郎(16:40~17:20)

- 3L1 47 口頭C講演 ブロック共重合体薄膜におけるミクロ相分離構造の三次元構造観察(京工織大繊維) 新原健一・松脇右京・西川幸宏・西 敏夫・陣内浩司
- 3L1 49 口頭C講演 水和ゼオライトのマイクロ波加熱による迅速再生と繰り返し再生利用する乾燥剤への応用(豊橋技科大) 長江真弓 大串達夫

## L2 会場

23号館304教室

半導体用材料の開発最前線

3月27日午後

座長 上野 智雄(13:00~17:20)

# お 知 ら せ

- 2L2 25 招待講演 高誘電率ゲート絶縁膜技術の課題と動向(東大院工)鳥海 明
- 2L2 29 招待講演 最先端CMOS低電力化に向けたHigh kゲートトランジスタ技術(日本電気システムデバイス研)最上 徹
- 2L2 33 依頼講演 High kゲート絶縁膜, およびそれを用いたトランジスタ作成技術(半導体先端テクノロジーズ) 鳥居和功・川原孝昭・三橋理一郎・金 雨植・青山知憲・神山 聡・田村泰之・大路西・北島 洋
- 2L2 36 依頼講演 HfO<sub>2</sub>系高誘電率ゲート絶縁膜材料の熱的安定性-分子動力学シミュレーション-(富士通研) 金田千穂子・小坂裕子・山崎隆浩
- 2L2 39 依頼講演 High kゲート絶縁膜実用化の課題(東芝セミコンダクター社)高柳万里子
- 2L2 42 依頼講演 High kゲート絶縁膜の形成と電気的特性評価(筑波大電子・物理) 山部紀久夫・後藤正和・樋口恵一・田辺正明・邱徳威・運沼 隆
- 2L2 45 依頼講演 希土類酸化物薄膜のHigh kゲート絶縁膜応用(東大院総合工)大見俊一郎
- 2L2 48 依頼講演 金属堆積とポスト酸化によるhigh k膜の作成(東農工大)上野智雄

## 未来材料

3月28日午後

座長 樋口 章二(13:00~14:00)

- 3L2 25 口頭D講演 深紫外用光ファイバー(昭和電線電纜) 大登正敬
- 3L2 28 口頭D講演 新規セルロースナノファイバー材料への取り組み(1)材料合成と分散技術(旭化成先端材料・融合研) 小野博文・望月久也

座長 大登 正敬(14:00~14:40)

- 3L2 31 口頭C講演 新規セルロースナノファイバー材料への取り組み(2)ナノファイバー不織布の製膜と膜特性(旭化成先端材料・融合研) 小野博文・林 稔・中村三樹彦
- 3L2 33 口頭C講演 多用途展開可能な成形加工性に優れた脂環式透明ポリイミド(KRI・丸善石化) 樋口章二・工藤昌章・飯塚徹也

座長 大和 洋(14:40~15:30)

- 3L2 35 口頭C講演 CZ法による大口径フッ化カルシウム単結晶の育成とその光学特性(トクヤマ・東北大学多元研) 柳 裕之・縄田輝彦・乾 洋治・西島英一・倉元信行・福田承生
- 3L2 38 口頭C講演 アミンイミド誘導体からの光塩基発生とこれを用いたエポキシ/チオール硬化システム(日立化成工業総合研・阪府大院工) 加藤木茂樹・白井正亮

座長 柳 裕之(15:30~16:10)

- 3L2 40 口頭C講演 環状脂肪族エポキシ樹脂の高機能化に関する検討(ダイセル機能商品開発セ) 前嶋 尚・高井英行・園尾且也
- 3L2 42 口頭C講演 自己傾斜型光触媒コーティング材の開発(旭化成ケミカルズ) 中林 亮・太田一也・小熊淳一・仁熊達郎

座長 中林 亮(16:10~17:00)

- 3L2 44 口頭C講演 高齢化社会に適應する調光レンズ材料(トクヤマつくば研) 和泉 忍・竹中潤治
- 3L2 46 口頭D講演 歯科材料に見る複合材料の組成設計と物性制御(トクヤマデンタル) 鈴木 健・風間秀樹

## L3 会場

23号館 305教室

プリント・ストレージ用材料の開発最前線

3月27日午後

## 銀塩

座長 横川 拓哉(13:30~15:00)

- 2L3 28 招待講演 デジタルイメージングにおける銀塩感光材料技術のポテンシャル(富士写真フィルム)高田俊二
- 2L3 31 招待講演 医療画像用デジタルドライイメージングフィルム(コニカミノルタエムジー)赤堀博美
- 2L3 34 口頭D講演 水系塗布技術で製造する医用熱現像感光材料の開発(富士写真フィルムデジタル&フォトイメージング材料研・富士写真フィルム先進コア技術研) 吉岡康弘・都築博彦・塚田芳久

座長 西村 基(15:00~16:00)

- 2L3 37 口頭D講演 1.1 ジオキソ 1.2.4 ペンゾジアジン系新規イエローカブラの開発(富士写真フィルム先進コア技術研) 竹内潔・上平茂生
- 2L3 40 口頭D講演 1Hピロロ[1,2-b][1,2,4]トリアゾール系新規シアンカブラーの開発(富士写真フィルム先進コア技術研) 嶋田泰宏・伊藤孝之・前田英樹・松岡光進・佐藤幸哉

座長 赤堀 博美(16:10~17:00)

- 2L3 44 招待講演 デジタル時代のカラーペーパー(富士写真フィルムデジタル&フォトイメージング材料研)大島直人
- 2L3 47 口頭C講演 超迅速処理カラーペーパー「EVER BEAUTY PAPER TYPE II for LASER」の開発(富士写真フィルム R&D 統括本部) 柴田直也・高田清人

座長 大島 直人(17:00~17:40)

- 2L3 49 口頭C講演 KONICA MINOLTA QA PAPER CENTURIA For Digitalの開発(コニカミノルタフォトイメージング) 西村 基・居野家 浩・高田 宏・渡辺泰宏
- 2L3 51 口頭C講演 モバイルプリンター用インスタント感材の開発(富士写真フィルム R&D 統括本部) 原 健史・小出智之

3月28日午前

## サーマル

座長 堀田 吉彦(9:00~9:30)

- 3L3 01 招待講演 レーザー熱転写技術と材料(千葉大工)北村孝司

座長 北村 孝司(9:30~10:50)

- 3L3 04 招待講演 サーマルリライタル記録の技術と動向(リコーサーマルメディアカンパニー)堀田吉彦
- 3L3 07 招待講演 昇華転写材料の動向 機能と用途展開(大日本印刷情報記録材料研)米谷伸二
- 3L3 10 依頼講演 可逆性感熱記録材料の素材設計と二色化技術(三菱製紙総研) 丸山 淳・名塚正範・佐野秀和

座長 丸山 淳(10:50~12:20)

- 3L3 12 口頭D講演 新規顔色剤UUの開発(旭化成ケミカルズ・横国大教育人間科学) 梶島和夫・小林博司・仲川 勉・松本真哉
- 3L3 15 口頭C講演 TAペーパーの開発(富士写真フィルムデジタル&フォトイメージング材料研) 島田浩一
- 3L3 17 依頼講演 フルカラーリライタルメディアおよび記録方法の検討(ソニーマテリアル研) 坪井寿憲・栗原研一・澤田真一
- 3L3 19 依頼講演 溶融型サーマルCTR(千葉大工)北村孝司

3月28日午後

座長 島田 浩一(13:00~14:00)

- 3L3 25 依頼講演 完全無現像CTP版(三井化学)小出哲裕
- 3L3 27 依頼講演 高速記録用サーマルヘッドの検討(アルプス電気) 寺尾博年・中谷壽文

## その他

- 3L3 29 口頭C講演 機能性色素を用いた $\gamma$ 線検出システムの開発(埼玉大工) 太刀川達也・時田澄男

## インクジェット

座長 林 広子(14:10~15:50)

- 3L3 32 招待講演 インクジェット染料の歩みと展望(キヤノン)野口

# お 知 ら せ

弘道

- 3L3 35 招待講演 フォトオレイティングジェットプリンタ用顔料インク技術(セイコーエプソン)竹本清彦  
3L3 38 依頼講演 顔料表面改質技術のインクジェット用途への応用(キャボット・スペシャルティ・ケミカルズ・インク)大嶋明博  
3L3 40 依頼講演 インクジェットフォトリソ印刷用染料の耐久性について(日本化薬機能化学品開発研) 清柳正幸・北山弘和・藤井隆文・川井田芳明

座長 野口 弘道(16:00~17:40)

- 3L3 43 口頭C講演 IJテキスタイルプリンタ用分散染料インクの開発(コニカミノルタテクノロジーズ) 川島保彦・森本仁士  
3L3 45 依頼講演 The Kinetics and Mechanism of Ozonolysis of Organic Dyes in Solution and Printed on IJ Media(アビシア) Paul Wight  
3L3 47 依頼講演 UVインクジェットプリント技術と応用(ミマキエンジニアリング) 大西 勝  
3L3 49 依頼講演 インクジェット記録媒体の現状と今後の展望(三菱製紙総研) 小池直正  
3L3 51 口頭C講演 写真画質インクジェット記録用紙の発色性向上技術(コニカミノルタフォトイメージング) 伊藤淳二・笠原健三

## L 4 会場 23号館 306 教室

### エネルギー変換材料

3月27日午後

座長 宇恵 誠(13:00~14:20)

- 2L4 25 基調講演 電子部品用電源の動向 特にDMFCとキャパシタ(早大理工) 逢坂哲彌  
2L4 29 基調講演 固体高分子型燃料電池の現状と課題(京大院工) 小久見善八

座長 金村 聖志(14:20~16:00)

- 2L4 33 依頼講演 携帯電話用燃料電池の研究開発動向(NTTドコモ・富士通研) 竹野和彦・代田玲美・猿渡紀男・武井文雄  
2L4 36 口頭D講演 ナノ構造電極の作製と高出力型再生電源への応用(産総研エネルギー技術) 本間 格・川岡広和・周 豪慎・日比野光弘  
2L4 39 口頭C講演 ゼルゲル法による薄膜型全固体リチウム二次電池の作製(都立大院工・CREST) 獨古 薫・保科圭吾・金村聖志  
2L4 41 口頭C講演 高速電荷移動界面設計を指向したルイス酸添加によるリチウムイオン二次電池電解質材料設計(東工大院理工) 古下智也・内本喜晴・脇原将孝

座長 安部 武志(16:00~17:20)

- 2L4 43 口頭C講演 全固体リチウム二次電池用ガラス材料の開発(阪府大院工) 林 晃敏・辰巳砂昌弘  
2L4 45 招待講演 電気二重層キャパシタの最新動向(日本ケミコン) 内 秀則  
2L4 48 招待講演 小型二次電池の開発動向(三洋電機) 米津育郎・吉村精司・藤谷 伸・能間俊之

3月28日午前

座長 本間 格(9:30~10:40)

- 3L4 04 招待講演 高出力用リチウム電池の開発現状(松下電池工業技術開発セ) 小西 始・生駒宗久  
3L4 07 口頭C講演 リチウム二次電池用ナノSi/SiO<sub>2</sub>C複合体負極活物質(東芝研究開発セ) 森田朋和・高見則雄  
3L4 09 口頭C講演 大型リチウム二次電池の開発(日立ピークルエンジニア) 堀場達雄

座長 辰巳砂 昌弘(10:40~12:00)

- 3L4 11 口頭C講演 5V級正極材料LiNi<sub>0.5</sub>Mn<sub>1.5</sub>O<sub>4</sub>スピネル酸化物の結晶構造と電気化学特性(東工大院理工) 小高裕史・白川淳一・三木 健・中山将伸・脇原将孝

- 3L4 13 口頭C講演 炭素微小球体の電気化学特性(京大院工) 安部 武志・王 宏宇・入山恭寿・小久見善八  
3L4 15 口頭C講演 電解液用新規添加剤の開発(三井化学MS研・三井化学触媒科学研) 林 剛史・檜原昭男・松岡 修・田辺信央  
3L4 17 口頭C講演 湿式オゾン酸化法によるホランダイト型二酸化マンガンの合成と電気化学特性(産総研) 木嶋倫人・高橋靖彦・秋本順二

3月28日午後

座長 吉武 優(13:00~15:30)

- 3L4 25 口頭C講演 空気中及び燃料ガス中の微量不純物が固体高分子燃料電池に及ぼす影響(新日本石油FC事業3部) 福永明彦・引田 寛・池田哲史・吉田正寛  
3L4 27 口頭C講演 カーボンナノファイバー担体を用いたDMFC用カソード触媒(東芝研究開発セ) 梅 武 中野義彦・末永誠一・米津麻紀・赤坂芳浩・大図秀行・五戸康広  
3L4 29 口頭C講演 固体高分子燃料電池シミュレータの開発(みずほ情報総研) 滝本正人・石塚辰美  
3L4 31 口頭C講演 ポリイミド多孔質膜の作製と燃料電池への応用(都立大院工) 棟方裕一・山本 大・獨古 薫・濱上寿一・武井 孝・金村聖志  
3L4 33 口頭C講演 PEFC並びにDMFC用固体高分子膜評価方法の確立(水蒸気収着・プロトン伝導度の同時測定) (日本ベル) 吉田将之・仲井和之  
3L4 35 依頼講演 モバイル用メタノール燃料電池(東芝研究開発セ) 五戸康広  
3L4 38 口頭C講演 固体高分子型燃料電池用MEAの電極構造解析(旭硝子中央研) 山本 清・川本昌子・滝本康幸・國狭康弘・山田耕太・田柳順一 向山 純

座長 高見 則雄(15:30~17:30)

- 3L4 40 口頭C講演 TiO<sub>2</sub>多孔質膜電極を用いるアンモニアの光燃料電池(茨城大理工) 金子正夫・片倉尚人・星野幹雄  
3L4 42 口頭C講演 BaCe<sub>1-x</sub>Y<sub>x</sub>O<sub>3-δ</sub>を電解質に用いた固体酸化物燃料電池の開発(東理大理工) 竹内 謙・Chun - Keung, Loong・Richardson Jr., James W.・Tae H., Lee・石田洋介・山中悠輝 粕谷健太・宇井幸一・小浦延幸  
3L4 44 口頭C講演 非対称アミドアニオンを用いたイオン性液体の開発と次世代電池用電解液への展開(トクヤマ) 松岡仁志・綿引ゆき・岩田在博・永倉直人・松永智徳・河原武男  
3L4 46 口頭C講演 イミダゾリウム系イオン性液体を用いたリチウム電池の検討(東芝研究開発セ) 猿渡秀郷・久保木貴志・岸 敬・高見則雄  
3L4 48 口頭C講演 高出力用高耐久電気二重層キャパシタの開発(旭硝子中央研) 吉田直樹・池田克治  
3L4 50 口頭C講演 ナノポーラス炭素の合成と高機能材料への応用(兵庫県立大院工・ダイセル化学工業) 福井和寿・福塚友和・松尾吉晃・杉江他曾宏・堤 聖晴・大前比登美・船木克典

## L 5 会場 23号館 307 教室

### ディスプレイ用材料の開発最前線

3月28日午前

#### 電子ペーパー：製品

座長 檀上 英利(9:00~10:30)

- 3L5 01 招待講演 電子ペーパーのねらいと動向(東海大工) 面谷 信  
3L5 05 依頼講演 磁場を併用したトナー粒子移動型表示式(コニカミノルタテクノロジーズ) 氷野 博  
3L5 07 依頼講演 ロイコ染料を用いたリライタブルペーパーの材料技術(リコー中央研) 筒井恭治

座長 岡村 寿(10:30~11:50)

- 3L5 10 依頼講演 トナーディスプレイの表示特性(千葉大工) 北村孝司

# お 知 ら せ

## 電子ペーパー：材料

- 3L5 12 依頼講演 アニオン性高分子の転相乳法を利用したマイクロカプセルの調製(化学技術戦略推進機構) 林 正樹・花田幸史・吉澤秀和
- 3L5 14 依頼講演 フルカラー電子ペーパーを目指すエレクトロクロミック材料の開発(化学技術戦略推進機構・千葉大院自然) 浦野光・春原聖司・小林範久
- 3L5 16 依頼講演 粒子内包化無機マイクロカプセルの合成(産総研) 藤原正浩

3月28日午後

## 電子ペーパー：ビジネス

座長 面谷 信(12:50~14:40)

- 3L5 24 招待講演 E Ink 電子ペーパーの商用化について(凸版印刷) 檀上英利

## 電子ペーパー：製品

- 3L5 28 依頼講演 ポリマーTFTアクティブマトリクス型電気泳動ディスプレイ(セイコーエプソンテクノロジープラットフォーム研) 守谷壮一・川瀬健夫・下田達也
- 3L5 30 依頼講演 磁気感熱式電子ペーパー「サーモマグ®」の開発(マジマ研究所) 真島 修
- 3L5 33 依頼講演 カラー光アドレス電子ペーパー(富士ゼロックス先端デバイス研) 有澤 宏・小林英夫・原田陽雄・五明 誠・岡野泰典

## 電子ペーパー：新材料

座長 前田 秀一(14:50~16:20)

- 3L5 36 口頭C講演 ゲストホスト液晶用アントラキノ二色性色素の開発(富士写真フイルム先進コア技術研) 加藤隆志・岡村 寿
- 3L5 38 口頭C講演 酸化チタンナノワイヤーの合成と光機能材料への応用(東北大多元研) 実平義隆・内田 聡
- 3L5 40 口頭C講演 塗布によるベンタセン薄膜形成とトランジスタへの応用(旭化成・光産業技術振興協会) 南方 尚・夏目 稔
- 3L5 42 依頼講演 フレキシブルフイルム液晶ディスプレイ(NHK技研) 藤掛英夫

## 電子ペーパー：ビジネス

座長 平倉 浩治(16:20~18:00)

- 3L5 45 依頼講演 コレステリック液晶を用いた電子ペーパー技術(コニカミノルタテクノロジーセ) 橋本清文
- 3L5 48 依頼講演 電子ペーパー搭載「リブリエ」が実現する世界(ソニー) 宇喜多義敬 大谷尚生

## 電子ペーパー：製品

- 3L5 51 招待講演 電子ペーパーの展望(王子製紙) 前田秀一

## L6 会場

23号館309教室

## ディスプレイ用材料の開発最前線

3月27日午後

## FED; デバイス

座長 高井 幹夫(13:00~14:10)

- 2L6 25 招待講演 ナノビジョンサイエンスの創成とFED(静岡大電子工研) 三村秀典
- 2L6 28 依頼講演 ナノシリコンを用いた弾道電子源(松下電工先行・融合技術研・東農工大工) 榎原 勉・幡井 崇・菟田卓也・越田信義
- 2L6 30 依頼講演 高効率電子放出素子(HEED)の開発とその応用(パ

イオニア総研・東農工大工) 酒村一到・田中亮太・中田智成・根岸伸安・奥田義行・佐藤英夫・渡辺 温・吉川高正・小笠原清秀・越田信義

座長 岡井 誠(14:10~15:30)

- 2L6 32 依頼講演 FED用蛍光体の研究開発動向(静岡大電子工研) 中本正幸
- 2L6 35 依頼講演 シリコンラダーポリマーのFED用ゲート絶縁膜材料への展開(三菱電機先端総研) 保田直紀・西村邦彦・鈴木洋介
- 2L6 37 依頼講演 FED用ガラス材料とガラスパネル構造の開発(旭硝子) 菅原恒彦

## FED; CNT

座長 三村 秀典(15:40~16:50)

- 2L6 41 招待講演 FEDのためのカーボンナノチューブ電子源の開発研究(阪大極限科学研究セ) 高井幹夫
- 2L6 44 口頭C講演 束状配向性カーボンナノチューブを電子源とした電界放出型冷陰極の開発(三菱ガス化学総合研) 藤井 尊・染谷昌男・大場道雄
- 2L6 46 依頼講演 カーボンナノチューブの合成(日機装開発セ) 八名純三

座長 菅原 恒彦(16:50~17:50)

- 2L6 48 依頼講演 アーク放電法によるカーボンナノチューブのフィールドエミッション特性(本庄ケミカル) 稲倉秀樹
- 2L6 50 依頼講演 印刷法により作製したCNT電子源の電子放出特性(日立ディスプレイズ・日立材料研) 岡井 誠・佐々木 進・宗吉恭彦・矢口富雄・藤枝 正・日高貴志夫
- 2L6 52 依頼講演 微細繊維状物質グラファイトナノファイバーの冷陰極ディスプレイへの応用(NHK技研) 後沢瑞芳

3月28日午前

## PDP: デバイス

座長 篠田 傳(9:00~11:00)

- 3L6 01 招待講演 PDPの現状と将来(パイオニアプラズマディスプレイ) 布村恵史
- 3L6 05 依頼講演 段違い井桁構造PDPの開発(松下電器産業PAVCS社) 安藤 亨・奥村茂行・真鍋勝利・水野耕一・高田祐助
- 3L6 07 依頼講演 PDP用光学フィルター(旭硝子AGC化学品カンパニー) 中尾卓也・森本 保・鈴木克巳・宮古強臣
- 3L6 09 依頼講演 フィルム直貼りタイプ光学フィルターの最新開発動向(三井化学機能材料研) 小池勝彦
- 3L6 11 口頭C講演 PDP用機能性フィルム(日立化成工業総合研) 上原寿茂

## PDP: コンポーネント

座長 布村 恵史(11:00~12:40)

- 3L6 13 招待講演 PDPにおけるマイクロ放電のメカニズム(京大院工) 橋 邦英
- 3L6 17 依頼講演 PDP用光学フィルターの特性(パイオニア) 小牧俊裕・大石利治
- 3L6 19 依頼講演 PDP放電セル構造における新構成要素 放電不活性膜(Discharge Deactivation Film=DDF)に関する材料・製造プロセス技術の開発(三菱電機京都製作所) 永野眞一郎・佐野 耕・城 啓介・原田茂樹
- 3L6 21 依頼講演 超大画面薄型プラズマチューブアレイ表示装置の開発(富士通研) 石本 学・粟本健司・篠田 傳

3月28日午後

## PDP: 部材

座長 小牧 俊裕(13:40~15:30)

- 3L6 29 招待講演 PDP用材料の開発状況(有機・無機材料) 富士通研 淡路則之
- 3L6 33 依頼講演 感光性ペーストの技術展開(東レ) 田中明彦・井戸英夫
- 3L6 35 依頼講演 PDP用ドライフィルム材料の開発(JSR ディスブ

# お 知 ら せ

- レイ研) 丹羽一明・山下隆徳・熊野厚司  
3L6 37 依頼講演 錫 リン酸系ガラスの熱特性(日本電気硝子) 菊谷武民・山本 茂・新藤和義

## PDP: 材料

- 座長 梶山 博司(15:40~17:20)  
3L6 41 招待講演 統合化計算化学システムによる PDP 保護膜材料の理論的設計(東北大未来科学技術共同研究セ・東北大院工・さきがけ・東大生研) 宮本 明・坪井秀行・古山通久・久保百司・梶山博司  
3L6 45 依頼講演 PDP 保護膜用 MgO 材料(タテホ化学工業) 庭野一久  
3L6 47 依頼講演 PDP 用珪酸塩系蛍光体の開発動向(鳥取大工・徳島文理大工) 大観光徳・國本 崇・小林洋志  
3L6 49 依頼講演 カラー PDP 用青色蛍光体の現状と開発動向(大電) 張 書秀

## L 7 会場

### 23 号館 310 教室

## エネルギー変換材料

3月27日午後

- 座長 柳田 祥三(13:00~13:50)  
2L7 25 招待講演 色素増感太陽電池の実用化に向けて(東理大工) 荒川裕則  
2L7 28 口頭 C 講演 酸化チタン基板上でのクロリン二量体の光電変換能の評価(名工大工) 石博修一・永田衛男・出羽毅久・山下啓司・天尾 豊・南後 守  
座長 宮坂 力(14:00~15:10)  
2L7 31 口頭 D 講演 色素増感型太陽電池用シール剤の開発(スリーボンド) 岸 克彦・三国博之  
2L7 34 基調講演 電力価格と次世代エネルギー変換技術(阪大先端セ) 柳田祥三

- 座長 荒川 裕則(15:20~16:20)  
2L7 39 招待講演 プラスチック色素増感太陽電池の高効率化とモジュール化(桐蔭横浜大院工) 宮坂 力  
2L7 42 口頭 D 講演 内部抵抗の解析による色素増感太陽電池の高効率化(シャープエコロジー技術開発セ) 韓 礼元・小出直城・千葉恭男・Islam, Ashrafur・古宮良一・福家信洋・福井 篤・山中良亮

- 座長 韓 礼元(16:30~17:30)  
2L7 46 口頭 C 講演 プラスチック色素増感光電極作製用バインダーフリーチタニアペーストの開発(桐蔭横浜大工・ベクセル・テクノロジーズ) 雉鳥優二郎・相原 航・宮坂 力  
2L7 48 口頭 C 講演 全固体型ポリマー色素増感太陽電池の高効率化(桐蔭横浜大院工) 池田信之・雉鳥優二郎・村上拓郎・宮坂 力  
2L7 50 口頭 C 講演 色素増感光キャパシタにおける光充電機能の向上(桐蔭横浜大院工) 村上拓郎・雉鳥優二郎・川島徳道・宮坂 力

3月28日午前

- 座長 元廣 友美(9:00~12:00)  
3L7 01 依頼講演 酸化チタンナノワイヤーの合成と色素増感太陽電池への応用(東北大多元研) 内田 聡  
3L7 04 口頭 C 講演 色素増感太陽電池電解液の多糖類による固体化と応用(茨城大理) 金子正夫・坂田真美・佐々木千恵  
3L7 06 口頭 C 講演 光強度変調分光法を用いた色素増感型太陽電池の電子伝導挙動評価(新日本石油中研) 朝野 剛・久保貴哉・坪倉章・錦谷禎範  
3L7 08 口頭 C 講演 新規なチタニア混合ナノ材料を用いる色素増感太陽電池(京大工能理工研) 足立基齊・高尾 潤・JIU, Jinting・中川敬三  
3L7 10 依頼講演 潜在性ゲル電解質 高性能大面積色素増感太陽電池

- 池を目指して(九大院生命体工) 早瀬修二  
3L7 13 口頭 C 講演 潜在性イオン性液体ゲル電解質前駆体を用いた擬固体型色素増感太陽電池(九工大生命体工) 加藤岳仁・岡崎昭夫・尾込裕平・高嶋 授・金藤敬一・山下浩一・早瀬修二  
3L7 15 口頭 C 講演 イオン性液体分子結合ナノ粒子からなるゲル電解質を使った色素増感太陽電池(九工大生命体工) 岡崎昭夫・門孝・高嶋 授・金藤敬一・早瀬修二  
3L7 17 口頭 C 講演 平坦化基板を用いた高性能色素増感太陽電池(DSS) (九工大生命体工・九工大工・新日鉄化学総研) 久保田幸記・渡嘉敷真哉・尾込裕平・加藤岳仁・門孝・藤本 誠・高嶋 授・金藤敬一・白土竜一・山下浩一・早瀬修二

3月28日午後

- 座長 内田 聡(13:00~14:10)  
3L7 25 依頼講演 色素増感太陽電池の開発(豊田中研) 元廣友美  
3L7 28 口頭 C 講演 Lewis モデルに基づく色素増感太陽電池電気化学性能シミュレータの開発(アドバンスソフト・産総研) 西村香純・松下 崇・杉中隆史・木部俊良・北尾 修  
3L7 30 口頭 C 講演 ポリピロロール/ステンレスメッシュを電荷蓄積電極に用いたエネルギー貯蔵型色素増感太陽電池(東大院工・東大院総合) 中川慶一・永井裕喜・瀬川浩司

- 座長 錦谷 禎範(14:20~15:20)  
3L7 33 口頭 C 講演 チタニアナノロッドを用いた色素増感太陽電池(京大工能理工研) Jiu, Jinting・Wang, F・足立基齊  
3L7 35 口頭 C 講演 メタルフリー色素を用いた高性能色素増感太陽電池(林原生物化学研東京研究セ) 大高秀夫・見手倉裕文・松井文雄  
3L7 37 口頭 C 講演 二酸化炭素超臨界液体を使った色素吸着, プロック分子吸着と色素増感太陽電池特性(九大院生命体工) 坂口昇平・門孝・尾込裕平・高嶋 授・山下浩一・金藤敬一・早瀬修二

- 座長 早瀬 修二(15:30~17:30)  
3L7 40 口頭 D 講演 ポリピロロールアクチュエータを用いた人工筋肉ポンプ(九大院生命体工・イメックス) 座間哲司・原 進・中山実・高嶋 授・金藤敬一  
3L7 43 口頭 D 講演 ジメチルエーテルの水蒸気改質による水素製造(静岡大工) 武石 薫・赤池好美  
3L7 46 口頭 C 講演 シロアリ由来 AM 21 B 菌株を用いる水素エネルギー回収型廃棄物処理システム(フレイン・エナジー) 鶴見里香・工藤靖博・須貝保徳・田口文章  
3L7 48 口頭 C 講演 有機積層型太陽電池における光電流発生機構の解明(阪大太陽工研セ) 大佐々崇宏・山本修平・松村道雄  
3L7 50 口頭 C 講演 粉末試料の紫外可視吸収スペクトル: 光導波路法による直接測定(東大院総合・システム・インストルメンツ) 小川桂一郎・原田 潤・藤原宗賢・高橋浩三

## L 8 会場

### 23 号館 311 教室

## プリント・ストレージ用材料の開発最前線

3月27日午後

## 記録材料

- 座長 北村 孝司(12:40~13:30)  
2L8 23 基調講演 イメージングのための材料開発 画像形成材料の視点から(東京工芸大芸) 大野 信

## 電子写真

- 座長 木村 正秋(13:30~15:10)  
2L8 28 招待講演 電子写真技術の本質的課題(リコー中央研) 坪倉浩治  
2L8 31 招待講演 市場からみた POD 品質要求と現状(富士ゼロックス先端デバイス研) 安部高志  
2L8 34 口頭 C 講演 トナー用ポリエステル樹脂(花王化学品研究所)

青木克敏・白井英治・久保貴史  
 2L8 36 口頭C講演 新規ゼログラフィックフォトペーパーの開発  
 (富士写真フィルムデジタル&フォトイメージング材料研) 村井  
 朝・宮宅一仁・藤本進二・後藤靖友・石塚 弘

座長 神山 幹夫(15:10~16:10)

2L8 38 口頭C講演 トナー添加剤用ヒュームドシリカの応用特性  
 (トクヤマ) 福寿忠弘・林 浩克・上田雅英  
 2L8 40 口頭C講演 電子写真プロセスにおけるケミカルトナーの概  
 論(富士ゼロックス) 木村正利  
 2L8 42 口頭C講演 重合法トナーの開発(日本ゼオン総合開発セ)  
 岸本琢治・長谷川 純

座長 内山 正喜(16:10~17:50)

2L8 44 口頭C講演 ポリエステル重合トナーの開発(リコー画像工  
 ンジン開発本部) 南谷俊樹・佐々木文浩・八木慎一郎・霜田直人・  
 樋口博一・粟村順一・富田正実  
 2L8 46 口頭C講演 乳化学合型重合トナー コノカミノルタデジ  
 タルトナー(コノカミノルタビジネステクノロジー) 神山幹夫  
 2L8 48 口頭C講演 EA製法トナー技術の適用拡大技術~汎用EA  
 トナーの開発(富士ゼロックス) 杉崎 裕・大矢康博・中沢 博  
 2L8 50 口頭C講演 電子写真用カラー現像剤(キヤノン) 瀧山晃一  
 2L8 52 口頭C講演 電子写真トナーのマイクロカプセル化(トッパ  
 ン・フォームズ) 江藤 桂

3月28日午前

光記録

座長 川田 善正(10:00~11:50)

3L8 07 招待講演 有機色素系光記録媒体~CD Rからブルーレーザ  
 ー対応記録まで~(太陽誘電) 浜田恵美子  
 3L8 11 招待講演 次世代高密度光メモリとしてのホログラム記録方  
 式と光記録材料(旭硝子中央研) 榎井宏巳  
 3L8 15 口頭D講演 耐光性オキソノール色素の開発と1/16倍速  
 DVD Rへの応用(富士写真フィルム先進研・富士写真フィルム記録  
 メディア研) 稲垣由夫・森島慎一・割石幸司・秋葉雅温・齋藤直  
 樹・市嶋靖司・御子柴 尚・柴田路広・橋本浩一・久保裕史

3月28日午後

座長 辻岡 強(13:00~14:30)

3L8 25 依頼講演 HD DVDと記録媒体技術(東芝研究開発セ) 芦田  
 純生・中居 司・大間知範威・柚須圭一郎・中村直正  
 3L8 28 依頼講演 カルコゲナイド薄膜の高速光学変化機構と2層  
 Blu ray Discへの応用(松下電器産業・松下テクノロジー) 山田  
 昇・児島理恵・西原孝史・松永利之  
 3L8 31 依頼講演 Blu ray Discに対応する無機系追記型記録媒体(パ  
 イオニア総研) 樋口隆信・細田康雄・志田宜義・今井哲也・三森歩  
 美・佐藤 恵・山口政孝

座長 前田 修一(14:30~17:20)

3L8 34 依頼講演 ハイブリッド硬化を利用したホログラム記録材料  
 (日本ペイント) 寺西 卓・佐藤晶彦・川畑政巳  
 3L8 38 依頼講演 フォトクロミック記録技術の現状と将来(阪教大  
 教育) 辻岡 強  
 3L8 41 依頼講演 粘着フィルムを用いた多層高密度光メモリ(静岡  
 大工・リンテック) 川田善正・中林正仁・宮田 壮  
 3L8 44 依頼講演 半導体レーザーを用いた三次元光メモリ用フォトク  
 ロミックリアールエンテへの2光子吸収記録(松下電器産業メディ  
 ア制御システム開発セ) 塩野照弘  
 3L8 47 口頭C講演 高効率2光子吸収化合物の開発(富士写真フイ  
 ルム先進コア技術研・山口大理) 秋葉雅温・滝沢裕雄・稲垣由夫・  
 谷 武晴・川俣 純  
 3L8 49 口頭C講演 バイオレットレーザー対応フォトポリマー  
 CTPシステムの開発(富士写真フィルム印刷材料研) 渋谷明規・國  
 田一人・小泉滋夫

P 会場

3月26日午前

(10:00~11:30)

化学教育・化学史

1PA 001 環境測定実験のマイクロスケール化:大気中の二酸化窒素  
 濃度測定(茨城大教育) 松川 寛・山崎優薫・佐藤一輝・有吉康昭  
 1PA 002 発泡スチロール球を用いた分子模型作製の化学実験への導  
 入の試み(茨城大教育) 荒井香澄・松川 寛 利安義雄  
 1PA 003 ベンゼンのマイクロスケール臭素化とニトロ化(広島大院教  
 育) 井上正之  
 1PA 004 デジタルビデオカメラ・顕微鏡・コンピュータを活用した  
 食塩結晶成長の教材化(北教大札幌) 田口 哲・松村幸子・小林周  
 朗・樋田拓至  
 1PA 005 栄養士の化学基礎教育における Minute Sheet の教育効果に  
 ついて(京都栄養医療専門学校) 北村新蔵  
 1PA 006 テクノアイデアコンテストを核とした高大連携の展開(京大  
 ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー) 川畑 弘・香取重尊・一野  
 天利・大森滋和・浦部匡史・宮崎 崇・松重和美  
 1PA 007 Webブラウザと分子表示プラグインによる抗生物質データ  
 集の作成(県立新潟女子短大) 本間善夫・金子祐子  
 1PA 008 生体分子ビリルビンの光反応系を用いた光化学の紹介のた  
 めの実験(光照射生成物の水溶性に及ぼす各種水溶液の影響) 琉球大  
 理) 漢那洋子  
 1PA 009 展開可能な立方体を用いた森林起点の新しい炭素循環学習  
 教材(コクヨ) 増田健司・白田和正・竹野淳一 青柳 充・舩岡正光

高分子

高分子合成

1PA 011 特殊なラジカル重合開始剤としてのトリ sec ブチルボラン  
 の性質(東北生活文化大短大) 菅野修一  
 1PA 012 新規なリビングラジカル重合開始剤としての(R) B イソピ  
 ノカンフィル 9 ポラビシク[C(3,3,1)]ノナンに関する研究(東北生活文  
 化大短大) 菅野修一 川奈誠和  
 1PA 013 空気雰囲気下におけるボラン-ピリジン錯体を開始剤とする  
 スチレンの特異的なラジカル重合(東北生活文化大短大) 菅野修一 町  
 田将大  
 1PA 014 RI(III)錯体によるメタクリル酸メチルのリビングラジカル  
 重合(日大理工) 亀田徳幸  
 1PA 015 マロン酸アリル誘導体の重合および共重合(信州大教育)  
 田中千穂・天助由佳理・漆戸邦夫  
 1PA 016 マルチサイトを有するマクロモノマーを用いた多岐状ボ  
 リスチレンの合成と物性(大日本インキ化学工業総合研) 野々川大  
 吾・山崎裕之・森田 毅・桜井美弥・森脇雅幸・早川 均・金 仁華  
 1PA 017 不斉アニオン重合による光学活性ポリ(N-マレオイル-Lロ  
 シン誘導体)の合成とその光学分割(山口大工) 中村太郎・張  
 淵・鬼村謙二郎 大石 勉  
 1PA 018 希土類金属のシリケートゲルを用いたビニルエーテル類の  
 重合(関東学院大工) 岩倉 賢・影山俊文・亀島敦子・杉崎俊夫・守  
 谷 治  
 1PA 019 NiおよびPd錯体触媒によるノルボルネン類の重合(日大文  
 理・オーエムケムテック) 松下くみ子・山本健雄・会田昭二郎・若  
 槻康雄  
 1PA 020 アリールアセチレン類により活性化されたタングステン錯  
 体を用いるノルボルネンの開環メタセシス重合におけるアセチレンの  
 置換基効果(横国大院工) 藤田 敦・山口佳隆・伊藤 卓  
 1PA 021 ルテニウムクラスター触媒を用いたシランにより誘起され  
 る3-エチル3-ヒドロキシメチルオキセタン類の重合反応(九大先導  
 研・九大院総理工) 安原樹志郎・本山幸弘・永島英夫  
 1PA 022 シクロデキストリンを開始剤とした環状エステル類の重合反  
 応機構の解明(阪大院理) 大崎基史・宮内雅彦・高島義徳・原田 明  
 1PA 023 5員環カーボネートを有するビスカルバメート類とヘキサ